

## 予定プログラム（※予告なく変更になる場合もございますので、予めご了承ください。）

時間	概要	担当者
13:00 - 14:15	<p><b>重機・建機業界におけるグローバル業界動向とデジタルイゼーションの導入状況</b></p> <p>新しいセンサー技術や新素材活用など、高性能で製品寿命の長い機械を製造しなくてはならない重機・建機メーカーにとって、グローバル競争、世界中の工場の連携、納期の短縮、TOCの削減、各種規制へ対応するための「デジタルイゼーション」は待ったなしです。設計/エンジニアリングから製造部門に至るまで共通のプラットフォーム上でコラボレーションを促進し、イノベーションの実現に影響を及ぼす3Dプリンティングを含めた新技術に対応することで、製造効率を高めなくてはなりません。このセッションでは、製品開発や生産のすべての状況で最適な決定を可能にするデジタル・ツインの実現方法、イノベーションを加速し変化する顧客のニーズに対応できるデジタル・エンタープライズへの変革方法をお話しします。</p>	<p>シーメンスPLMソフトウェア 産業機械/重機業界担当 バイスプレジデント ラファール・ガーグ</p>
14:15 - 14:45	<p><b>イノベーションを実現するシーメンスのエンド・ツー・エンド・アディティブ・マニファクチャリング・ソリューション</b></p> <p>シーメンスはアディティブ・マニファクチャリング・ソリューションに設計、シミュレーション、製造を含むPLMシステム全体に継続的な投資を行うとともに、製造オペレーション管理 (MOM) によるショップフロア管理、品質管理を含めた工場全体のE2Eソリューションを顧客に提供しています。また、シーメンス自体が製造業であるため、自社製品の3Dプリンティング技術によるものづくりを行っています。本セッションでは、ソフトウェアを提供する側、使用する側の両視点からのシーメンスの取り組みをご紹介します。</p>	<p>シーメンスPLMソフトウェア ポートフォリオ開発本部 Digital Enterprise Realization シニア営業マネージャ 丸山 貴弘</p>
14:45 - 15:00	休憩	
15:00 - 15:45	<p><b>「かたち」を再創造する! アイデアをかたちにするNXによる次世代設計手法</b></p> <p>製造方法の制約から解放されたジェネレーティブデザインと呼ばれる新たな設計手法が注目されています。</p> <p>NXでは、アディティブマニファクチャリングに対応した次世代の設計手法に対応すべくボロジー最適を用いたジェネレーティブデザインや従来のソリッド・サーフェス・モデリングにファセットを組み合わせたコンバージェントモデリング、多彩なラティス構造やアディティブ・マニファクチャリングを加味したチェックツールなどさまざまな機能を実装しております。本セッションでは、次世代の設計手法に対応したNXの機能群をご紹介します。</p>	<p>シーメンスPLMソフトウェア プリセールス本部PL 布施 泰志</p>
15:45 - 16:30	<p><b>イノベーションを実現する設計環境! 製造制約から解放された自由な構造設計を可能にするシミュレーション技術</b></p> <p>アディティブ・マニファクチャリングにより製造制約から解放された自由な構造設計を可能にする Simcenter 3Dのシミュレーション技術について、位相最適化解析、形状最適化解析およびそれら最適化解析の連動、ラティス構造のシミュレーション適用技術などを含めてご紹介いたします。さらにアディティブ・マニファクチャリング製造プロセス特有の現象をシミュレーションで予測する技術的な取り組みもご紹介いたします。</p>	<p>シーメンスPLMソフトウェア プリセールス本部 シミュレーション シミュレーション3D担当 上席コンサルタント 佐藤 英一</p>
16:30 - 17:00	<p><b>製造を再構築する! 多彩な加工技法に対応するNXのアディティブ・マニファクチャリング向けCAMシステム</b></p> <p>近年のアディティブ・マニファクチャリングの製造技法は、さまざまな方法が考案されています。代表的にはSLA/SLMやDED(LMD)、MJFやFDM、EBAMなど、対象となるアプリケーションに応じて多くの技法が考案され、その機械が市場にリリースされています。実際の製造現場での課題として、それぞれの技法や機械向けのソフトウェアを使用する必要があり、現場の足かせとなっているのではないのでしょうか。本セッションでは多様な技法に対応するNX CAMのAMモジュールについてご紹介いたします。</p>	<p>シーメンスPLMソフトウェア ポートフォリオ開発本部 丸山 貴弘</p>
17:00 - 17:10	全体Q&Aセッション	